

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN	
基準値 ²⁾	汚泥の場合 ²⁾	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.06	0.2	0.1	0.3	5	
	廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.6	2	1	1	0.1	
	処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.6	2	1	1	0.1
	廃酸、廃アルカリ以外の場合	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.06	0.2	0.1	0.3	5	
排出源		適用																									
業種	施設																										
37. 前6号以外の石油化学工業	メ 酸濃縮施設																										
	メ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設																										
	ラ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設																										
	ロ メチルメタクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設																										
	タ 廃ガス洗浄施設																										
41. 香料製造業	イ 洗浄施設																										
	ロ 抽出施設																										
43. 写真感光材料製造業	感光剤洗浄施設																										
46. 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業	イ 水洗施設																										
	ロ ろ過施設																										
	ニ 廃ガス洗浄施設																										
47. 医薬品製造業	ロ ろ過施設																										
	ハ 分離施設																										
	ニ 混合施設																										
	ホ 廃ガス洗浄施設																										
49. 農薬製造業	混合施設																										
50. 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬製造業	試薬製造施設																										
51. 石油精製業	イ 脱塩施設																										
	ロ 原油常圧蒸留施設																										
	ハ 脱硫施設																										
	ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設																										
	ホ 潤滑油洗浄施設																										
51の2. 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブ製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業	直接加硫施設																										
53. ガラス又はガラス製品製造業	イ 研磨洗浄施設																										
	ロ 廃ガス洗浄施設																										
56. 繊維原料精製業	イ 水洗式破砕施設																										
	ロ 水洗式分別施設																										
	ハ 酸処理施設																										
	ニ 脱水施設																										

物質名	アルキルHg	蒸Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN				
基準値 ¹⁾	汚泥の場合 ²⁾		ND	0.06	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.1	0.3	3			
	廃酸・廃アルカリの場合 ²⁾		ND	0.06	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1		
	処理物 ³⁾	廃酸・廃アルカリの場合	ND	0.06	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1		
廃酸・廃アルカリ以外の場合		ND	0.06	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.1	0.3	3				
排出源		適用																											
業種	施設																												
61. 鉄鋼業	イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設									○																	○		
62. 非鉄金属製造業	イ 還元そう ロ 電解施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設	○	○						○																			○	
63. 金属製品製造業又は機械器具製造業	イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設	○	○						○	○																			○
64. ガス供給業又はコークス製造業	イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設									○																		○	
65. 酸又はアルカリによる表面処理施設				○	○			○	○																				○
66. 電気めっき施設				○	○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
66の2. 旅館業	ハ 入浴施設									○																			
67. 洗濯業	洗浄施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○									
68. 写真現像業	現像洗浄施設			○						○																			
71の2. 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設	イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
71の5. トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設											○	○	○																
71の6. トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設												○																	
写真感光材料製造業	溶解施設											○																	
石油精製業	改質施設															○	○												
トリニトロトルエン鉛製造施設					○																								
青化法精製施設									○																				
石油製品製造業	蒸留施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○								○	
廃油	イ 蒸留施設 ロ 表面処理施設										○	○		○	○	○	○	○	○									○	
アセチレン精製施設		○	○																										
その物質による表面処理施設											○	○	○	○	○			○											
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設																	○												

物質名	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN		
基準値 ¹⁾	汚泥の場合 ²⁾		ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	2	0.6	0.2	0.6	0.6	0.2	0.1	0.3	3		
	廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾		ND	0.06	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
	処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.06	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
廃酸、廃アルカリ以外の場合		ND	0.05	0.5	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	2	0.6	0.2	0.6	0.6	0.6	0.2	0.1	0.3	3		
排出源		適用																									
業種	施設																										
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理施設																											
指定下水汚泥		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
※1 硫酸パルプ又は亜硫酸パルプ製造の蒸素又は蒸素化合物漂白施設																										○	
※2 カーバイト法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設																										○	
※3 硫酸カリウム製造施設のうち、廃ガス洗浄施設																										○	
※4 アルミナ繊維製造施設のうち、廃ガス洗浄施設																										○	
※5 塩化ビニルモノマー製造施設のうち、二塩化エチレン洗浄施設																										○	
※6 カプロラクタム製造施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設																										○	
※7 クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造施設のうち、水洗浄施設、廃ガス洗浄施設																										○	
※8 4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設																										○	
※9 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設																										○	
※10 ジオキサジンバイオレット製造施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設																										○	
※11 アルミニウム又はその合金製造焙焼炉等の発生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																										○	
※12 亜鉛回収施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																										○	
※13 廃棄物焼却炉（火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が50kg/h以上のもの）の発生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの																										○	
※14 廃PCB等又はPCB処理物分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物洗浄施設又は分離施設																										○	
※15 担体付き触媒の製造（塩素又は塩化水素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設																										○	

物質名	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	DXN					
	基準値 ¹⁾	汚泥の場合 ²⁾		ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.56	0.03	0.2	0.1	0.3	3	
廃酸・廃アルカリの場合 ²⁾		ND	0.5	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1			
処理物 ³⁾		廃酸・廃アルカリの場合	ND	0.5	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1		
		廃酸・廃アルカリ以外の場合	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.56	0.03	0.2	0.1	0.3	3		
排出源		適用																											
業種	施設																												
※16 担体付き触媒（使用済みのものに限る。）から金属の回収（ソーダ灰を添加してばい焼炉で処理する方法及びアルカリによる抽出する方法（ばい焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの																													○
※17 フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法に限る。＊1）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの																													○

- 1) 基準値mg/ℓ（溶出量）。ただしDXNの「汚泥」、「処理物の廃酸・廃アルカリ以外」はng-TEQ/g（含有量）、「廃酸・廃アルカリ」、「処理物の廃酸・廃アルカリ」はng-TEQ/ℓ（含有量）
 - 2) 国内で生じたものであって、表中の排出源の施設から生じたもの
 - 3) 1) を処分するために処理したもの
 - 4) 環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
- (注) 業種番号と施設記号は水質汚濁防止法施行令別表第1による。
 ※印の業種番号と施設記号はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2による。
 基準値は総理府令第5号（ダイオキシン類は環境省令）、廃棄物処理法施行規則別表1（廃酸、廃アルカリ）による。